科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 30 年 6 月 11 日現在

機関番号: 14301 研究種目: 若手研究(B) 研究期間: 2016~2017

課題番号: 16K17845

研究課題名(和文)固体 - プラズマハイブリッドカソードを用いたレーザー駆動高強度短パルス電子源の実証

研究課題名(英文) Demonstration of laser-driven ultrafast and intense electron source with solid-plasma hybrid cathode

研究代表者

井上 峻介(Shunsuke, Inoue)

京都大学・化学研究所・助教

研究者番号:40724711

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,700,000円

研究成果の概要(和文):高強度短パルスレーザーを固体標的に照射した際に駆動される電子パルスは、高輝度、極短パルスといった特徴を有しており、超高速に変化する現象を観察可能な電子源としての可能性を秘めている。高強度レーザーにより加速される電子のうち、そのほとんどはシース電場と呼ばれる極めて強い準静的な電場に捉えられてしまうため、利用可能な電子は極めて少なかった。本研究では、電子放出を増強するため新標的として、固体-プラズマハイブリッドカソードを提案し、これを用いた短パルス電子ビーム発生装置の開発を実施した。

研究成果の概要(英文): Fast electrons accelerated through interactions of intense femtosecond laser pulses with solid target have great potential as a probe pulse to observe ultrafast phenomena, because they have advantages of high intensity and a short pulse. However, the most of the fast electrons cannot use as the probe pulse because they are trapped by a strong quasi-static electric field, called the sheath field, produced around the steep density gradient boundary. We proposed a solid-plasma hybrid cathode as a new target to increase the number of fast electrons escaping from the sheath field, and developed a short pulse electron beam generator with this target.

研究分野: プラズマ科学

キーワード: 高強度レーザー 短パルス電子源 高強度電子源

1.研究開始当初の背景

電子や中性子、X線等の量子ビームを用い た物質構造解析は、原子サイズの高い空間分 解能を有している。このため、基礎物理、物 質科学から生命科学等の広範な分野におい て、今日までの目覚ましい発展に多大な貢献 をしており、これらの分野において必要不可 欠な手法となっている。さらなる物質内諸現 象の観察を行うべく、近年、"短パルス"の 量子ビームを用いることで物質中の超高速 に変化する現象を捉える研究が急速に発展 している。 特に、数 10keV から数 100keV の エネルギーを持つ電子パルスは、溶解や凝固、 化学結合の切断と結合といった、ピコ秒から フェムト秒の間に変化する内部構造変化や、 超高速に変化するレーザープラズマ電磁場 の測定などへ応用が期待され、精力的に研究 されている。パルス幅が短く、1パルスあた りの電子数の多い高強度短パルス電子源を 開発できるか否かが、これら超高速現象研究 のさらなる発展の鍵を握っている。しかしな がら、フォトカソード RF 電子銃やフォトカ ソード DC 電子銃に代表される従来型の電子 源は、空間電荷効果のために電子の短パルス 化と高強度化の両立が本質的に困難である という問題を抱えている。さらに、フォトカ ソード表面の光学損傷のため、1パルスあた りの電子数を飛躍的に増大させることが難 しい。超高速現象研究のさらなる発展のため には、現行手法に替わる超高強度短パルス電 子源の開発が必須となっている。我々は、高 強度フェムト秒レーザーにより直接加速さ れる高エネルギー電子に着目し、これを用い た新たな短パルス電子源の開発を行ってき た。集光強度が 10¹⁸ W/cm² を超える高強度 フェムト秒レーザーを固体薄膜に集光照射 すると、微小な領域に瞬間的に高エネルギー 密度状態のプラズマが生成され、高エネルギ の電子が加速される。このレーザー加速電 子パルスは空間電荷効果や光学損傷の問題 がなく、高強度な電子線を発生させることが できる。また、高強度短パルスレーザーによ り電子の加速が同時に行われるため、別途電 子加速装置を付随させる事なく相対論速度 の電子を発生させることができ、装置の小型 化や、真空槽内の低真空度化が達成されるた め、新たな高強度短パルス電子源としての可 能性を秘めいている。こまでに、レーザー加 速電子パルスを超高速現象観測へ応用する ための基礎研究を行いさらに数100フェムト 秒という超高速に変化するレーザープラズ マ電場の測定に成功することで、短パルス電 子源としての有効性を世界に先駆けて示し てきた。

2 . 研究の目的

申請者は独自に開発したレーザー加速電子分析器による実験中、強度の異なる二つのレーザーを、遅延時間を与えて固体薄膜へ照射すると、電子数が飛躍的に増大する現象を

発見していた。本現象を精緻に調べた結果、固体にあらかじめプラズマを付加した物質を電子源のためのカソードとして用いたため高強度化が実現していることを突き止めた。この"固体・プラズマハイブリッドカソード"を用いて、電子の数が1pCを超える超高強度電子源の実証に成功した(図1)。

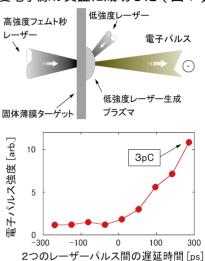


図1二つのレーザー照射による電子パルス 高強度化実験の模式図と実験結果

さらに、数値シミュレーションによると、 本カソードより放射される電子パルスの時間幅は短く、短パルス電子ビーム発生装置を 新たに開発することで、超高強度短パルス電子源の実現が可能であることが示唆されている。本研究ではこの固体 - プラズマハイブリットカソードを用いることで、"短パルス"と"高強度"を同時に満たした、世界最高の電子源の実証を目的とした。

3. 研究の方法

固体 - プラズマハイブリッドカソードは こつのレーザーパルスを照射することで生 成される。これまでの研究により、本カソー ドの性能は非常に多くの条件に依存するこ とが明らかとなっている(それぞれのレーザ ーパルスのエネルギー、照射強度、照射タイ ミング、照射角度、カソード材質など)。短 パルス電子発生装置へ本カソードを実装す るためには、レーザーの出力や光学素子の設 置場所などへの制限があるため、これまでの 研究により見出されていた条件を大幅に変 更する必要がある。これらの条件を最適化す ることで、1pC を超える電子数を放射可能、 かつ短パルス電子発生装置へと実装可能な カソードの開発を実施する。さらに、この固 体 - プラズマハイブリッドカソードを実装 可能な、短パルス電子ビーム発生装置の設計 及び製作を行う。開発済みの短パルス電子ビ - ム発生装置は、カソード部分に二つのレー ザーを照射することを想定していないため、 大幅な設計変更が必要になる。本装置に用い られる各々の素子について再設計し、新規装 置を開発する。最後に、開発した短パルス電

子ビーム発生装置より得られる電子のパルス幅、及び電子数を測定することで、超高強度短パルス電子源を実証する。

4. 研究成果

(1) 時間分解干渉計の構築によるプラズマ密度分布の測定

本実験では2つのフェムト秒レーザーパ ルス(ここでは CPA1、及び CPA2 と呼称す る)を、数 100 ピコ秒の遅延時間を与えて照 射することでレーザー加速電子パルスの強 度を向上することに成功している。この原因 は、先に照射される強度の低いフェムト秒レ ーザー (CPA2、強度: 1 × 10¹⁵ W/cm²) によ り生成されるプラズマが、固体薄膜ターゲッ トの密度空間分布に変調を与えているため である。変調は大きいほど良いことが理論に より示されているが、これまで、遅延時間は 数 100ps しか与えることができなかった。 そ こで、長時間の遅延時間を与えることのでき る遅延光路を新たに構築し、電子パルスの高 強度化を試みた。また、その際に形成される プラズマの大きさを観察するための時間分 解光干渉計を新たに構築し、ナノ秒のスケー ルで膨張しているプラズマの密度や形状を 測定した。

時間分解干渉計によるプラズマ密度分布の測定結果と、同時に撮影されたシャドウグラフを図1に示す。CPA2 照射より Ops、500psおよび1.47ns後のシャドウグラフと干渉ののである。CPA2 照射より1.47ns後に、スケール長がおよそ25umのプラズマが存在に発った。さらに詳細につりであることが明らかとなった。さらに詳細につりであるでの膨張を調べ、その密度分布を図2により解析したものを図2にです。プラズマがおよそ100-200km/sの速だで膨張しており、遅延時間を大きくとるほととなった。

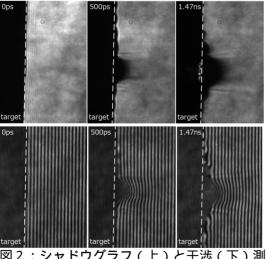


図2:シャドウグラフ(上)と干渉(下)測 定結果

(2) 電子エネルギースペクトル測定による電子パルス特性の測定

時間分解干渉計によるプラズマ密度の測定とともに、加速電子パルスの重要な特性で

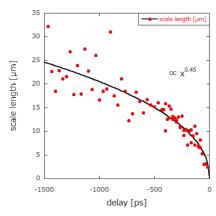


図3:電子密度分布の時間発展

あるエネルギースペクトルを計測した。これらの測定を通して、短パルス電子発生装置へと実装可能な、高強度電子パルスを発生させるための固体 - プラズマハイブリッドカソードの生成条件を詳細に調べた。

電子エネルギースペクトルを測定した結果を図4に示す。グラフ中の色はCPA1とCPA2の間に与えた遅延時間の違いを表している。遅延時間を増大させることで、発生する電子の数を大幅に増大させることができており、固体・プラズマハイブリッドカソードが機能している様子が分かる。また、1.47nsの遅延時間を与えた場合、検出器へと到達した総エネルギーは、CPA2を照射しない時の場合に比べておよそ10倍であった(図5)。

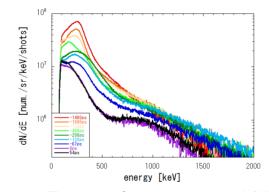


図4:電子エネルギースペクトルの遅延時間 依存性

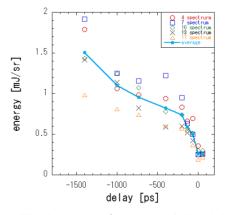


図5:電子総エネルギーの遅延時間依存性

(3) 固体 - プラズマハイブリッドカソードに よる電子ビーム高強度化

(1)および(2)により得られた条件をもとに、 固体 - プラズマハイブリッドカソードより 発生する電子をビームとして取り出し、その 電子数やビーム径を測定した。固体 - プラズ マハイブリッドカソードより放出される電子を、新たに設計した電子レンズによりビームとしてコリメートし、蛍光スクリーンへと 像転送した。この電子ビームの空間プロフリストルを高感度冷却 CMOS カメラにより観察した。さらに遅延時間や CPA2 の強度と共に これらのパラメータがどう変化するかを測定して、固体-プラズマハイブリッドカソードの性能を評価した。

固体 - プラズマハイブリッドカソードを 用いて電子ビームが高強度化される様子を 図 6 示す。CPA2 レーザーを照射しプラズマを 形成させることで、CPA2 を照射しなかった場 合に比べて極めて高強度な電子ビームを取 り出すことに成功している。図7は、電子ビ ームプロファイルの遅延時間依存性を表し ている。赤い丸で示されたプロットは電子ビ ームの強度、青い四角で示されたプロットは 電子ビームの直径をそれぞれ示している。電 子ビーの直径を保ったまま、電子ビームの強 度が次第に強くなっている様子が分かる。こ の結果は、(1)により得られたプラズマの膨 張から予想された通りであり(図2) 固体 - プラズマハイブリッドカソードが設計通 りに機能していることが明らかとなってい る。さらなる高強度化を目指し、CPA2の照射 強度を変更し、同様に電子ビームプロファイ ルの遅延時間依存性を測定した結果を図8 に示す。電子ビーム強度はさらなる高強度化 を示したが、その出力はショットごとに不安 定なものとなった。CPA2 により固体が完全に 破損され、CPA1 到達時に固体 - プラズマハイ ブリッドカソードとして機能していないこ とが原因であると予想される。本結果は、固 体薄膜ターゲットの材質や厚さなどの調整 により更なる最適化ができる可能性がある ことを示唆しており、今後の課題となってい る。



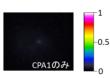


図 6: CPA2 を照射した場合(左)としなかった場合(右)の電子ビームプロアイル

(4) 短パルス電子発生装置の開発

固体 - プラズマハイブリッドカソードから放射される電子パルスを高効率に伝送する電子レンズや電子パルスを圧縮するための磁気パルス圧縮器などの、短パルス電子ビーム発生装置の個々の磁気光学素子について再設計・試作・試験を行い、短パルス電子

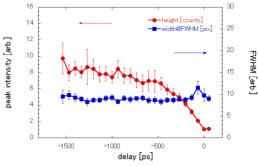


図7:電子ビームプロファイルの遅延時間依存性 (CPA2、強度:1×10¹⁵ W/cm²)

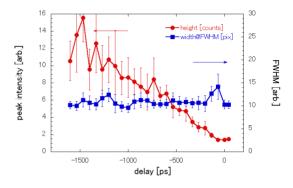


図 8:電子ビームプロファイルの遅延時間依存性 (CPA2、強度: 2 × 10¹⁶ W/cm²)

ビーム発生装置の開発を行った。これらの電子光学素子の設計には、二つの計算コード (静磁場計算コード; POISSON SUPERFISH パッケージ、及び三次元荷電粒子軌道計算コード; GENERAL PARTICLE TRACER コード)を用いた。

開発した短パルス電子ビーム発生装置を用いて撮影された金の回折像を図9に示す。左側が金の単結晶を撮像したもの、右側が金の多結晶を撮像したものである。単結晶の場合、高次の回折まで明瞭に観察することができ、これまで不可能であった単一照射による金多結晶像の撮影にも成功した。この時の電子はおよそ0.2pCであった





図9:単一短パルス電子による金単結晶(左) 及び多結晶(右)の回折像。

(5) 電子パルス幅の測定による超高強度短パルス電子源の実証

短パルス電子ビーム発生装置を用いて得られた電子パルスのパルス幅を測定した。測定は高強度フェムト秒レーザーと電子ビームを交差させ、各々の直接相互作用を利用した相互相関を計測する方法により計測した。電子パルスとレーザーパルスを時・空間的に同期して交差させると、電子パルスの一部がレーザーパルスにより散乱される。この時散

乱された電子数と散乱される力の大きさの 積を相関関数として測定する。相互相関関数 は、フェムト秒レーザーのパルス幅と集光径、 及び短パルス電子ビームのパルス幅、ビーム サイズなどの積分として解析的に解くこと で求めた。短パルス電子ビームの生成に当た っては、短パルス電子ビーム発生装置の様々 な磁気光学装置やレーザーパルスなどを、前 述の数値計算コードを用いながら調整し、実 験結果とのフィードバックを行ながら実施 した。

図10に測定結果を示す。横軸は強度フェムト秒レーザーと電子パルスとの相対的な遅延時間を、縦軸は高強度短パルスレーザーと電子パルスの相関関数を示しており、赤点で示されたプロットが実験結果を、実線は結果をガウス関数でフィッティングしたものである。相関関数の半値全幅は143fsであり、電子ビームのパルス波形がガウシアンであると仮定すると、パルス幅がおよそ110fsの電子ビームを得ることに成功した。

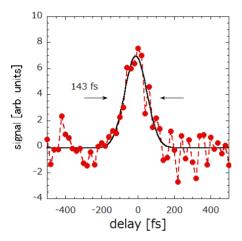


図10:高強度短パルスレーザーと電子パルスを相互作用させることにより得られた相関関数。

まとめ

強度の異なる二つのレーザーを、遅延時間を与えて固体薄膜へ照射することで得られる"固体・プラズマハイブリッドカソード"を用いて"短パルス"と"高強度"を同時に満たした、世界最高の電子源の実証を目的に、世界最高の電子源の実証を目的により、本の様々な条件の検討と、これを実装置へとインストールするための様々な条件の検討と、これを実計を関係を実施した。得られた電子のパルス幅と電子数を測定すると、それぞれ 0.2pC,110fs であった。カソード材料の検討により、10fs であった。カソード材料の検討により、つ後の課題である。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 2件)

<u>Shunsuke Inoue</u>, Yoshihide Nakamiya, Kensuke Teramoto, Masaki Hashida, and Shuji Sakabe

"Highly intensified emission of laser-accelerated electrons from a foil target through an additional rear laser plasma,"

Phys. Rev. Accel. Beams vol. 21, 041302 (2018)

<u>Shunsuke Inoue</u>, Kazuya Maeda, Shigeki Tokita, Kazuaki Mori, Kensuke Teramoto, Masaki Hashida, and Shuji Sakabe

"Single plasma mirror providing 10⁴ contrast enhancement and 70% reflectivity for intense femtosecond lasers" Applied Optics Vol. 55, Issue 21, pp. 5647-5651 (2016)

[学会発表](計 6件)

<u>井上峻介</u>、寺本研介、小島 完興、橋田昌 樹、阪部周二

"フェムト秒レーザー加速電子を用いた電磁場の時間分解イメージング測定"

日本物理学会 第 73 回年次大会、東京理科 大学 野田キャンパス (2018 年 3 月 22 日 ~ 25 日)

<u>井上峻介</u>、中宮義英、寺本研介、小島 完 興、橋田昌樹、阪部周二

"高強度レーザー駆動短パルス電子による 動的な電磁場のラジオグラフ測定"

レーザー学会学術講演会 第 38 回年次大会、 京都府京都市勧業館みやこめっせ(2018年1月24日~26日)

<u>井上峻介</u>、中宮義英、寺本研介、橋田昌樹、 阪部周二

" 超高速現象観測のための固体薄膜-プラズ マ複合ターゲットによるレーザー加速電子 源 "

Plasma Conference 2017、兵庫県姫路市姫路 商工会議所 (2017 年 11 月 20 日~24 日)

<u>井上峻介</u>、中宮義英、寺本研介、橋田昌樹、 阪部周二

" 固体 - プラズマ複合ターゲットからのレ ーザー加速電子パルスの特性 "

日本物理学会 第 72 回年次大会、大阪大学 豊中キャンパス (2017年3月17日~20日)

<u>井上峻介</u>、中宮義英、寺本研介、橋田昌樹、 阪部周二

"レーザー駆動高強度電子源のための固体-プラズマ複合ターゲット"

レーザー学会学術講演会 第37回年次大会、 徳島大学 常三島キャンパス(2017年1月7日~9日)

"固体プラズマハイブリッドターゲットに よるレーザー加速電子パルスの高強度化" 第 77 回 応用物理学会 秋季学術講演会、新 潟県新潟市朱鷺メッセ (2016年9月13日~ 16日) [図書](計 0件) 〔産業財産権〕 出願状況(計 0件) 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 国内外の別: 取得状況(計 0件) 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 取得年月日: 国内外の別: 〔その他〕 ホームページ等 6.研究組織 (1)研究代表者 井上峻介(INOUE, Shunsuke) 京都大学, 化学研究所, 助教 研究者番号: 40724711 (2)研究分担者 () 研究者番号: (3)連携研究者) (研究者番号: (4)研究協力者

(

)

井上峻介、中宮義英、寺本研介、橋田昌樹、